中文版 | English

登录 注册

资源化学研究室知识库

ALL 精确检索请加双引号 Go 欢

首页 研究单元&专题 作者 文献类型 学科分类 知识图谱 新闻&公告

XJIPC OpenIR > 资源化学研究室

基于双拥挤效应的低模板消耗安石榴林印迹方法

刘辉胜; 孙光映; 阿吉艾克拜尔·艾排[1]

2016-07-20

专利权人	中国科学院新疆理化技术研究所
专利类型	发明专利

摘要 本发明涉及一种基于双拥挤效应的低模板消耗安石榴林印迹方法，该方法以聚苯乙烯、聚乙二醇为两种大分子拥挤试剂，以极少量的安石榴林为模板分子，在加入了两种拥挤试剂聚苯乙烯、聚乙二醇的四氯仲碳溶液以及甲苯异氰酸酯的混合液孔洞中，再加入双酚氧杂、交联剂顺反发酵，经常规法进解开除安石榴林的氰气开引发反应，得到具有选择性的安石榴林印迹整体柱。本发明所述方法模板消耗量极少，极大地降低了安石榴林的印迹成本。在不锈钢柱管中成功合成了安石榴林印迹整体柱及其空白对照柱并进行色谱性能优化。结果表明，印迹因子最高可达3.14，该方法制备简单，且高分子聚合物耐用性好，为安石榴林的分离纯化提供了一种节约成本的方法。

申请日期	2016-03-04
申请号	CN201610125967.1
公开（公告）号	CN105771941A
代理机构	乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106
文献类型	专利
条目标识符	http://irbianshanzw.cn/handle/365002/6511
专题	资源化学研究室
推荐引用方式 GB/T 7714	刘辉胜,孙光映,阿吉艾克拜尔·艾排. 基于双拥挤效应的低模板消耗安石榴林印迹方法. CN105771941A[P]. 2016-07-20.

条目包含的文件

条目无相关文件。

个性服务
推荐此条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[刘辉胜]的文章
[孙光映]的文章
[阿吉艾克拜尔·艾排]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[刘辉胜]的文章
[孙光映]的文章
[阿吉艾克拜尔·艾排]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[刘辉胜]的文章
[孙光映]的文章
[阿吉艾克拜尔·艾排]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享

所有评论 (0) 发表评论/异议/意见

暂无评论

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

首页 研究单元产出分布图 收录类型分布图 论文引用排行 作者 文献类型 学科分类 关于网站 使用帮助 联系我们

条目量 6347 全文量 4606 访问量 940549 下载量 12162 中科院机构知识库网格

版权所有 @2018 - 2024 中国科学院新疆理化技术研究所 - Powered by CSpace

地址邮编: 新疆乌鲁木齐市北京南路40-1号（830011） 电话: 0991-3838931